日本国特許庁

PATENT OFFICE
JAPANESE GOVERNMENT

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日

4

Date of Application:

1999年 3月 3日

出願番号

Application Number:

平成11年特許顯第056102号

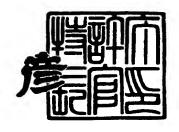
出 願 人 Applicant (s):

パイオニア株式会社

2000年 1月21日

特 許 庁 長 官 Commissioner, Patent Office

近藤隆



特平11-056102

【書類名】

特許願

【整理番号】

PPN98109

【提出日】

平成11年 3月 3日

【あて先】

特許庁長官殿

【国際特許分類】

H05B 33/06

【発明の名称】

スイッチング素子及び有機エレクトロルミネッセンス素

子表示装置

【請求項の数】

12

【発明者】

【住所又は居所】

埼玉県鶴ヶ島市富士見6丁目1番1号 パイオニア株式

会社 総合研究所内

【氏名】

今井 邦男

【特許出願人】

【識別番号】 000005016

【氏名又は名称】 パイオニア株式会社

【代理人】

【識別番号】

100079119

【弁理士】

【氏名又は名称】

藤村 元彦

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 016469

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】 9006557

【プルーフの要否】

要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 スイッチング素子及び有機エレクトロルミネッセンス素子表示 装置

【特許請求の範囲】

【請求項1】 互いに積層された絶縁膜と有機物からなる有機薄膜とからなる 積層体を挟む一対の対向するゲート電極と、前記有機薄膜と前記絶縁膜との間に 配置された中間電極と、からなることを特徴とする有機薄膜スイッチング素子。

【請求項2】 前記有機物は絶縁性有機化合物であることを特徴とする請求項1記載の有機薄膜スイッチング素子。

【請求項3】 前記有機物は少なくとも電子輸送性及び正孔輸送性の一方の 材料であることを特徴とする請求項2記載の有機薄膜スイッチング素子。

【請求項4】 前記中間電極は前記ゲート電極間の前記有機薄膜及び前記絶縁膜間の界面に配置された互いに離間する一対の対向電極からなることを特徴とする請求項1~3のいずれか1記載の有機薄膜スイッチング素子。

【請求項5】 複数の発光部からなる表示配列を有している有機エレクトロルミネッセンス素子表示装置であって、

前記発光部に対応する複数の第1表示電極が表面上に形成された基板と、

前記第1表示電極の各々上に形成され、少なくとも1層の電子及び又は正孔の 注入によって発光する有機エレクトロルミネッセンス材料層を含む有機材料層と

前記有機材料層上に共通に形成された第2表示電極と、

前記基板上に形成されかつ前記第1及び2表示電極の少なくとも一方に接続されかつ、互いに積層された絶縁膜及び有機物からなる有機薄膜を挟む一対の対向するゲート電極、並びに、前記ゲート電極間の前記有機薄膜及び前記絶縁膜間の界面に配置された中間電極からなる有機薄膜スイッチング素子と、からなることを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子表示装置。

【請求項6】 前記有機薄膜スイッチング素子の前記有機物からなる有機薄膜は前記有機材料層の一部からなることを特徴とする請求項5記載の有機エレクトロルミネッセンス素子表示装置。

【請求項7】 前記発光部はマトリクス状に配置されたことを特徴とする請求項5又は6記載の有機エレクトロルミネッセンス素子表示装置。

【請求項8】 前記基板上に形成されかつ前記第1及び2表示電極並びに前 記有機薄膜スイッチング素子の少なくとも一方に接続されたコンデンサを有する ことを特徴とする請求項5記載の有機エレクトロルミネッセンス素子表示装置。

【請求項9】 前記基板及び前記第1表示電極が透明であることを特徴とする請求項5記載の有機エレクトロルミネッセンス素子表示装置。

【請求項10】 前記有機薄膜スイッチング素子の前記中間電極は前記ゲート電極間の前記有機薄膜及び前記絶縁膜間の界面に配置された互いに離間する一対の対向電極からなることを特徴とする請求項5~9のいずれか1記載の有機エレクトロルミネッセンス素子表示装置。

【請求項11】 前記有機薄膜スイッチング素子の前記中間電極及びキャリア注入用の前記ゲート電極は、キャリアが正孔の場合は高仕事関数を有する材料からなり、キャリアが電子の場合は低仕事関数を有する材料からなることを特徴とする請求項5~10のいずれか1記載の有機エレクトロルミネッセンス素子表示装置。

【請求項12】 前記有機薄膜スイッチング素子の前記中間電極は、前記有機薄膜と略等しい仕事関数を有する材料からなる第1層とこれより高い仕事関数を有する材料からなる第2層とからなる積層体、或いはこれより低い仕事関数を有する材料からなる第2層とからなる積層体からなることを特徴とする請求項11記載の有機エレクトロルミネッセンス素子表示装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、有機物からなる有機薄膜を利用したスイッチング素子に関し、また、電子及び正孔の注入によって発光する有機化合物材料のエレクトロルミネッセンス(以下、ELともいう)を利用したかかる有機EL材料の薄膜からなる発光層を備えた有機EL素子、並びに、該スイッチング素子、の複数をマトリクス状に配置した有機EL素子表示装置に関する。

[0002]

【従来の技術】

低消費電力及び高表示品質並びに薄型化が可能なディスプレイとして、有機E L素子の複数をマトリクス状に配列して構成される有機EL素子ディスプレイが 注目されている。図1に示すように、各々の有機EL素子200は、例えばイン ジウム錫酸化物いわゆるITOからなる透明電201が形成されたガラス板など の透明基板1上に、電子輸送層、発光層、正孔輸送層などからなる少なくとも1 層の有機材料層202、及び金属電極203が積層されたものである。透明電2 01の陽極にプラス、金属電極203の陰極にマイナスの電圧を加え、すなわち 、透明電極及び金属電極間に直流を印加することにより、有機材料層202の中 の発光層が発光する。

[0003]

有機EL素子において、金属陰極から注入された電子と透明陽極から発光層へ 注入された正孔との再結合によって励起子が生じ、この励起子が放射失活する過 程で光を放つ。よって、有機EL素子200は、電気的には、図2のような等価 回路にて表すことができる。図から分かるように、素子は、容量成分Cと、該容 量成分に並列に結合する非対称導電性の発光ダイオード成分Eとによる構成に置 き換えることができる。よって、有機EL素子は、容量性の発光素子であると考 えられる。有機EL素子は、直流の発光駆動電圧が電極間に印加されると、電荷 が容量成分Cに蓄積され、続いて当該素子固有の障壁電圧または発光閾値電圧を 越えると、透明電極(ダイオード成分Eの陽極側)から発光層を担う有機材料層 に電流が流れ初め、この電流に比例した強度で発光する。かかる素子の電圧V-電流I-輝度Lの特性は、ダイオードの特性に類似しており、発光閾値Vth以下 の電圧では電流Iはきわめて小さく、発光閾値Vth以上の電圧になると電流Iは 急激に増加する特性である。また、電流Iと輝度Lはほぼ比例する。このような 有機EL素子は、発光閾値Vthを超える駆動電圧を素子に印加すれば当該駆動電 圧に応じた電流に比例した発光輝度を呈し、印加される駆動電圧が発光閾値Vth 以下であれば駆動電流が流れず発光輝度もゼロのままである。

[0004]

有機EL素子表示装置は、交差している行と列において配置されたいわゆるマトリクス状に配置された複数の発光画素すなわち有機EL素子からなる画像表示配列を有している発光装置である。この有機EL素子表示装置の駆動方法の一例には、単純マトリクス駆動方式と呼ばれるものがある。単純マトリクス駆動方式の表示装置は、複数の陽極線と陰極線とをマトリクス(格子)状に配置し、このマトリクス状に配置した陽極線と陰極線の各交点位置毎に有機EL素子を接続し、この陽極線と陰極線のいずれか一方を一定の時間間隔で順次選択して走査すると共に、この走査に同期して他方の線を駆動源で駆動することにより、任意の交点位置の有機EL素子を発光させるようにしたものである。この方式ではアクセス時間だけ各有機EL素子が点灯するので、大型画面にするには、大電流及び高電圧が必要となる。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】

表示装置の大型画面化には、単純マトリクス駆動方式有機EL素子表示装置の他に、アクティブマトリクス駆動方式のものが考えられる。これは、上記の陽極線及び陰極線を走査信号ライン及びデータ信号ラインに置き換え各交点位置毎にスイッチング素子に薄膜トランジスタ(TFT:Thin Film Transistor)を用いてスイッチングによって画素毎に電流を供給して有機EL素子を発光させるようにしたものである。TFTにはp-Si、a-Siからなる素子が採用され得、また代わりにMOS-FET(Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor)を用い構成することもできる。

[0006]

例えば、スイッチング素子のMOS-FETでは、半導体例えばSi基板上に2つの 反転伝導領域を形成し、該反転伝導領域間の基板表面上に酸化物Si〇₂薄膜、 金属ゲート電極を順に設け、金属ゲートから印加される電界により、基板表面の 伝導性を制御するものである。したがって、ディスプレイ基板にSiウエハ、ポリシリコン基板になど半導体基板が必要であり、その上に無機材料の成膜が必要 であるので、高温プロセスがその製造に用いられる。

[0007]

特平11-056102

表示装置のディスプレイとしては大型のものに対する需要が多いが、高温プロセスを製造に必要とする無機材料スイッチング素子をアクティブマトリクス駆動方式の有機EL素子表示装置の大型ディスプレイに用いると、表示装置の高価格化は避けられない。

そこで、本発明の目的は、比較的低温で作成できる有機薄膜スイッチング素子を提供すること、並びに有機薄膜スイッチング素子を共通の基板上に形成した有機EL素子表示装置を提供することにある。

[0008]

【課題を解決するための手段】

本発明の有機薄膜スイッチング素子は、互いに積層された絶縁膜と有機物からなる有機薄膜とからなる積層体を挟む一対の対向するゲート電極と、前記有機薄膜と前記絶縁膜との間に配置された中間電極と、からなることを特徴とする。

本発明の有機薄膜スイッチング素子においては、前記有機物は絶縁性有機化合物であることを特徴とする。

[0009]

本発明の有機薄膜スイッチング素子においては、前記有機物は少なくとも電子 輸送性及び正孔輸送性の一方の材料であることを特徴とする。

本発明の有機薄膜スイッチング素子においては、前記中間電極は前記ゲート電 極間の前記有機薄膜及び前記絶縁膜間の界面に配置された互いに離間する一対の 対向電極からなることを特徴とする。

[0010]

本発明の有機エレクトロルミネッセンス素子表示装置は、複数の発光部からなる表示配列を有している有機エレクトロルミネッセンス素子表示装置であって、

前記発光部に対応する複数の第1表示電極が表面上に形成された基板と、

前記第1表示電極の各々上に形成され、少くとも1層の電子及び又は正孔の注 入によって発光する有機エレクトロルミネッセンス材料層を含む有機材料層と、

前記有機材料層上に共通に形成された第2表示電極と、

前記基板上に形成されかつ前記第1及び2表示電極の少なくとも一方に接続されかつ、互いに積層された絶縁膜及び有機物からなる有機薄膜を挟む一対の対向

するゲート電極、並びに、前記ゲート電極間の前記有機薄膜及び前記絶縁膜間の 界面に配置された中間電極からなる有機薄膜スイッチング素子と、からなること を特徴とする。

[0011]

本発明の有機エレクトロルミネッセンス素子表示装置においては、前記有機薄膜スイッチング素子の前記有機物からなる有機薄膜は前記有機材料層の一部からなることを特徴とする。

本発明の有機エレクトロルミネッセンス素子表示装置においては、前記発光部はマトリクス状に配置されたことを特徴とする。

[0012]

本発明の有機エレクトロルミネッセンス素子表示装置においては、前記基板上 に形成されかつ前記第1及び2表示電極並びに前記有機薄膜スイッチング素子の 少なくとも一方に接続されたコンデンサを有することを特徴とする。

本発明の有機エレクトロルミネッセンス素子表示装置においては、前記基板及 び前記第1表示電極が透明であることを特徴とする。

[0013]

本発明の有機エレクトロルミネッセンス素子表示装置においては、前記有機薄膜スイッチング素子の前記中間電極は前記ゲート電極間の前記有機薄膜及び前記 絶縁膜間の界面に配置された互いに離間する一対の対向電極からなることを特徴 とする。

本発明の有機エレクトロルミネッセンス素子表示装置においては、前記有機薄膜スイッチング素子の前記中間電極及びキャリア注入用の前記ゲート電極は、キャリアが正孔の場合は高仕事関数を有する材料からなり、キャリアが電子の場合は低仕事関数を有する材料からなることを特徴とする。

[0014]

本発明の有機エレクトロルミネッセンス素子表示装置においては、前記有機薄膜スイッチング素子の前記中間電極は、前記有機薄膜と略等しい仕事関数を有する材料からなる第1層とこれより高い仕事関数を有する材料からなる第2層とからなる積層体、或いはこれより低い仕事関数を有する材料からなる第2層とから

なる積層体からなることを特徴とする。

[0015]

【発明の実施の形態】

発明者は、有機EL素子の導電機構を詳細に検討する過程において、対向する 陰極及び陽極から有機薄膜すなわち有機材料層に20KHzのパルス電圧を加え ると、電圧に応じて電荷を有機薄膜の一定の深さまで注入できることを知見し、 本発明に到った。有機薄膜の厚さ方向に電圧を加えると有機薄膜に電荷が存在で きるので、有機薄膜内に別のソースやドレインなどの中間電極を配置し、その電 極に電流を流すことが可能になる。すなわち、有機EL素子に用いられ得る材料 の導電機構を用いて、有機薄膜の厚さ方向に電圧を印加し、膜厚又は面方向の電 流をスイッチングできることになる。

[0016]

以下に、本発明による実施例を図面を参照しつつ説明する。

図3に示すように、第1の実施例の有機薄膜スイッチング素子10は、ガラスなどの基板1上に形成された電界印加用のゲート電極2上にポリイミドなどの有機化合物からなる絶縁層3を形成して、その上に形成されている。有機薄膜スイッチング素子10は、ゲート電極2が埋め込まれた絶縁層3の上に形成された有機化合物からなる有機薄膜4と、有機薄膜4中に離間して配置されるように形成された中間電極すなわち一対の対向する金属電極5及び6と、金属電極5及び6並びにそれらの間隙上の有機薄膜4に接触するように形成されたゲート電極7と、からなる。ゲート電極7は対向するゲート電極2と協働して金属電極5及び6並びにそれらの間隙の有機薄膜4に電界を印加する。ゲート電極7は、金属電極5及び6間を結ぶ直線に対して交差する電気力線の電界を印加するように配置されている。有機薄膜4は、電子輸送性及び又は正孔輸送性の絶縁性有機化合物である。有機薄膜4は、例えば、ポリチオフェンなどがある。

[0017]

本発明では、有機薄膜に直接設けたゲート電極7に正又は負の電圧を印加した とき、有機薄膜に直接電荷が注入できることに着目して、素子のチャネルとなる 正孔輸送性又は電子輸送性の有機薄膜を挟むようにゲート電極に設けてあり、ゲ ート電極7直下の有機薄膜のチャネルに正孔又は電子を注入する。有機薄膜スイッチング素子10においては、正孔輸送性の有機薄膜4に、正の電圧を印加し、電界を生ぜしめると、正孔が有機薄膜4に注入され、金属電極5及び6の間にて正孔輸送性の有機薄膜がチャネルとなる。または、電子輸送性の有機薄膜4に、負の電圧を印加し、電界を生ぜしめると、電子が有機薄膜4に注入され、金属電極5及び6の間の電子輸送性の有機薄膜がチャネルとなる。この状態で金属電極5及び6すなわちソース電極とドレイン電極に電位差を与えて、有機薄膜に注入された正孔又は電子をキャリアとし電流を流すことにより、ゲート電圧を0n/0ffすることでソース電極5からドレイン電極6への電流をスイッチングできる。

[0018]

図3に示すように、有機薄膜スイッチング素子において、有機薄膜チャネルに直接接合したゲート電極7にON電圧をかけて有機薄膜チャネルに電荷を注入すると、注入された電荷により対向金属電極5及び6間に電流が流れる。また、ゲート電極7の電圧をOFFすると注入電荷がなくなり電流が流れなくなる。アクティブマトリクス駆動における有機EL素子の制御は、ゲート電圧による電流の細かい制御は必要ないので、電流のON/OFFができる有機薄膜スイッチング素子が2個あれば実現できる。

[0019]

この有機薄膜スイッチング素子では、有機薄膜の上下に酸化珪素などの無機電気絶縁性の薄膜を設けておらず、有機薄膜にゲート電極を直接つける構造になっている。本発明により、スイッチング素子のゲート電圧は、絶縁膜を介さずに直接印加できるので、ゲート電圧を大幅に低下できる、また素子が容量性でなくなるためにスイッチングの応答が速くなる。さらに、本発明のスイッチング素子は、一般に高温プロセスを必要とする無機質絶縁材料を用いないために、比較的低温で素子を作成でき、有機EL素子の電流制御などの有機機能素子の制御に最適である。

[0020]

さらに、図4に示すように、有機薄膜スイッチング素子において、図3に示す 対向金属電極の一方の電極5を省略することもできる。すなわち、本発明の第2 の実施例では少なくとも1つの中間電極があればよい。この有機薄膜スイッチング素子11は、電界を印加するゲート電極の一方7から電荷を有機薄膜4へ注入し、さらにドレイン電極6へ流す構成である。

[0021]

図5に、アクティブマトリクス駆動方式による第3の実施例の有機EL素子表示装置における表示パネルの一部を示す。この表示パネル109は、マトリクス状に配置されかつ各々が赤色R、緑色G及び青色Bの3つの発光部(有機EL素子)からなる発光画素111の複数からなる画像表示配列を有している。画素1つの発光部当たり、2個の有機薄膜スイッチング素子10、11及びコンデンサ300からなる有機薄膜スイッチング回路と、有機EL素子200とから構成される。このような発光部組合せユニットが各画素ごとに全画素数の数だけ集積され、マトリクス状に配置された複数の発光画素からなる画像表示配列の有機EL素子表示装置の基板が形成されている。

[0022]

この有機EL素子表示装置のガラス基板上には、有機EL素子200及びコンデンサ300を挟んで平行に伸長するアノードライン12及びデータ信号ライン13が設けられ、さらにこれらラインから電気的に離間して直交する位置に配列され伸長するカソードライン15及び走査信号ライン16が設けられている。データ信号ライン13へのRGB信号に応じて走査信号ライン16を順次走査して、交点画素の有機EL素子200を選択発光させる。

[0023]

図6は第3の実施例に表示パネルの単位画素に対応する1つの発光部の回路構成を示す。有機薄膜スイッチング素子11のゲートG1は、走査回路からの行を走査する走査信号が供給される走査信号ライン16に接続され、一方、有機薄膜スイッチング素子11のソースSは、フレームメモリのデータに対応した書込み回路からの信号が供給されるデータ信号ライン13にゲートG2とともに接続されている。

[0024]

有機薄膜スイッチング素子11のドレインDは有機薄膜スイッチング素子10

のゲートG2及びコンデンサ300に接続され、コンデンサ300を通じてカソードライン15に接続されている。

有機薄膜スイッチング素子10のソースSはアノードライン12に接続され、 有機薄膜スイッチング素子11のドレインDは有機EL素子200のITO陽極 すなわち第1表示電極に接続され、一方、有機EL素子200の金属陰極を通じ てカソードライン15に接続されている。有機薄膜スイッチング素子10のゲー トG1もカソードライン15に接続されている。アノードライン12及びカソー ドライン15は電源回路に接続されそれぞれ制御される。

[0025]

このような回路が行及び列に複数配列された表示パネル109の単位画素の発 光制御動作は、つぎの通りである。有機薄膜スイッチング素子11のゲート電極 間にオン電位差が供給されると、有機薄膜スイッチング素子11はソースSに供 給されるデータの電圧に対応した電流をソースSからドレインDへ流す。

有機薄膜スイッチング素子11のゲート電極間がオフ電位差であると有機薄膜スイッチング素子11はいわゆるカットオフとなり、有機薄膜スイッチング素子11のドレインDは開状態となる。従って、有機薄膜スイッチング素子11のゲート電極間がオン電位差の期間に、ソースSの電圧に基づいた電流でコンデンサ300が充電され、その電圧が有機薄膜スイッチング素子10のゲートG2に供給される。有機薄膜スイッチング素子10はそのゲート電圧に基づき閉状態となり、電流がアノードライン12を通じてソースSからドレインD、有機EL素子200のITO陽極へ流れ、有機EL素子200を発光せしめる。

[0026]

有機薄膜スイッチング素子11のゲート電極間がオフ電位差になると、有機薄膜スイッチング素子11は開状態となり、有機薄膜スイッチング素子10はコンデンサ300に蓄積された電荷によりゲートG2の電圧が保持され、次の走査まで電流を維持し、有機EL素子200の発光も維持される。

次に、有機EL素子表示装置の表示パネル109の製造工程を説明する。

[0027]

図7に示すように、まず、それぞれITOからなるアノードライン12、デー

タ信号ライン13、コンデンサの一方の電極301及び第1表示電極の透明電極 (陽極)201をガラス基板1上に形成する。データ信号ライン13の電極301に対向する部分に有機薄膜スイッチング素子11のソースS及びゲートG2となる領域7aが存在し、コンデンサ用電極301のアノードライン12に対向する部分に有機薄膜スイッチング素子10のゲートG2となる領域2aが存在する。ITOからなるラインを示しているが、ラインの上にA1などの低い抵抗率の金属を更に積層してもよい。

[0028]

図8に示すように、ITOの各導電部を備えている基板1の上に、発光する有機エレクトロルミネッセンス材料層を含む有機材料層を積層させるために第1表示電極の透明電極201を露出させる開口を有した感光性ポリイミド等の絶縁層3を成膜する。ここで、有機薄膜スイッチング素子11のコンデンサに接続するためのドレイン用のコンタクトホール11a及び有機薄膜スイッチング素子10のアノードライン12に接続するためのソース用のコンタクトホール12aを形成しておく。

[0029]

次に、図9に示すように、有機薄膜スイッチング素子11のドレイン電極6及びこれをコンデンサにコンタクトホール11aを介して接続する導電部6aのA1の帯状体と、有機薄膜スイッチング素子10のゲートG2となる領域2a上にソース電極5となる端部を有するA1の帯状体5aと、同じ領域2a上にソース電極6となる端部を有するA1の帯状体6aと、を絶縁層3上に真空蒸着などで成膜する。A1の帯状体5a及び6aは、有機薄膜スイッチング素子10電極となる側の反対の他端部はアノードライン12及び第1表示電極の透明電極201にそれぞれ接続されるように、成膜する。

[0030]

次に、図10に示すように、正孔輸送層4aを基板全面に成膜する。

次に、図11に示すように、正孔輸送層4a上の第1表示電極の透明電極20 1に対応する上に、所定のEL媒体成膜用マスクを用い、R、G及びBの発光有機EL媒体4を所定膜厚に成膜する。マスク開口が1つの第1表示電極201上

特平11-056102

からその隣接する第1表示電極上へ配置されるようにマスクを順次移動せしめ、 成膜する。なお、基板表面の平坦化をなすためや、コンデンサの容量調整のため に、2つの有機薄膜スイッチング素子、有機EL媒体以外に、他の誘電体をその 対応部分に成膜することもできる。

[0031]

次に、図12に示すように、成膜用マスクを取り除き、A1-Li等の低仕事 関数の金属を、成膜された3種類の有機EL媒体の上に蒸着、あるいはスパッタ 等の手段を用いて陰極の第2表示電極203として成膜する。この金属膜の膜厚 は支障のない限り厚く被着させても構わない。この第2表示電極形成工程では、 下層のアノードライン12及びデータ信号ライン13に交差するように、隣接す る第2表示電極203を接続するカソードライン15や、走査信号ライン16を 同時に成膜し、更に同時にカソードライン15に接続するコンデンサの対向電極 302や、有機薄膜スイッチング素子11のゲート電極G1も成膜する。

[0032]

作製された有機EL素子表示装置における有機薄膜スイッチング素子11及び10の断面図をそれぞれ図13及び14に示す。有機薄膜スイッチング素子11、10及び有機EL素子200が略同一平面に形成されている。

このように、本発明によれば有機薄膜スイッチング素子と有機EL素子アレイを同時に作製することが可能となり、高精彩なフルカラーディスプレイが実現できる。

[0033]

次に、図15は、第4の実施例における有機EL表示装置を示し、有機薄膜スイッチング素子及び有機EL素子アレイを搭載した表示パネルを用いた表示装置のブロック図である。図において、101はA/D変換回路、102は演算回路、103はフレームメモリ、104はコントローラ、105は走査回路、106は書き込み回路、107は電源回路、108は電流値メモリ、109は表示パネルを示す。

[0034]

A/D変換回路101は、アナログ映像信号入力を受けてデジタル映像信号デ

ータに変換する。変換されたデジタル映像信号はA/D変換回路101から演算回路102へ供給され、電流値メモリ108からのデータを基にコントローラ104の制御により演算処理をされてフレームメモリ103へ供給され、コントローラ104の制御により書き込み蓄積される。この演算処理については後述する。コントローラ104は、入力映像信号の水平及び垂直同期信号に同期してフレームメモリ103ほか電源回路107までの各回路を制御する。

[0035]

フレームメモリ103に蓄積されたデジタル映像信号データは、コントローラ104によって読み出され、書き込み回路106に送られる。また、表示パネルの行及び列すなわち走査信号ライン16及びデータ信号ライン13に接続された走査回路105及び書き込み回路106をコントローラ104で順次制御することにより、フレームメモリに蓄積されていた画像に対応した表示パネル109の有機EL素子の発光時間を例えばサブフィールド法等により制御して所望の画像表示が得られる。電源回路107は、表示パネル109の全有機EL素子への電源をアノードライン12及びカソードライン15を介し供給し、コントローラ104によって制御される。また、電流値メモリ108は、表示パネル109の各有機EL素子である有機EL素子の駆動電流に対応した値を記憶しておき、コントローラ104によって制御される。

[0036]

ここで上記演算処理について説明する。上述したように電流値メモリ108には各有機EL素子の駆動電流に対応した値がコントローラ104により指示されたときに記憶される。例えば、表示装置の電源を断とする前に表示パネル109の全有機EL素子に対しコントローラ104から同一輝度データに対応する発光制御を行う。

[0037]

これは、表示パネル109の全有機EL素子を同一の定電圧で駆動することを意味する。各有機EL素子はそれぞれ駆動電流に対する発光輝度特性が異なれば同一電圧の駆動でも異なった発光電流を示す。通常頻繁に高輝度で発光される有機EL素子は発光輝度特性の劣化が他の有機EL素子よりも進行し、この定電圧

駆動の場合の発光電流が他の有機EL素子よりも少なくなる。

[0038]

従って、発光輝度特性の劣化が最大の有機EL素子の発光電流を基準に他の有機EL素子の駆動電流を補正し、補正された発光階調データに基づいて有機EL素子の発光時間を制御することにより表示パネル109の全有機EL素子の発光状態を入力映像信号に正確に比例した画像表示を得ることが可能となる。

上述したような方法でコントローラ104の制御に従って電流値メモリ108には補正用の電流値が記憶されており、次に演算回路102はコントローラ104の制御に従って所定の記憶された電流値を読み込み、例えば前述した各有機EL素子の発光電流が最小の値の基準値によって除することで基準値に対するレシオを輝度データの補正値として演算により求める。

[0039]

求められた補正値は、発光電流の最小値を基準値とすることにより1以上の値となる。この求められた各画素に対する補正値で演算回路102への入力デジタル映像信号データを除することによって補正されたデジタル映像信号データとしてフレームメモリ103へ供給する。

電流値メモリ108へ値を送るための電流検出器は、有機EL素子200と直列に接続され、有機EL素子200に流れる電流を検出する。A/D変換回路によりデジタルデータとされた値は電流値メモリ108に記憶される。電流検出器は、有機薄膜スイッチング素子10のソースと接地の間に設けても良い。

[0040]

次に、上記第4の実施例の有機EL表示装置に用いられる表示パネル109の単位画素及びその1つの発光部の対応する回路構成をそれぞれ図16及び図17に示す。第4の実施例の表示パネルは、上記第3の実施例と基本的に同様であるので、図において既述の同一符号にて示す部材の説明及び発光制御動作は省略する。第4の実施例の表示パネルにおいて、カソードライン15a及び15bは、アノードライン12及びデータ信号ライン13と平行になるように設けられている。またカソードライン15a及び15bは、画素アレイの外部で接続されている。カソードライン15aは走査信号ライン16と交差するので、走査信号ライ

ン16の交差部分を埋め込む構成としてある。カソードライン15bは、有機E L素子200とアノードライン12との間に設けられている。

[0041]

図17に示すように、コンデンサ300bが追加されており、有機薄膜スイッチング素子10のゲートG2に接続されている有機薄膜スイッチング素子11のドレインDが、コンデンサ300及び300bを通じてカソードライン15a及び15bにそれぞれ接続されている。コンデンサ300及び300bを積層して構成することにより、容量素子をコンパクトにでき、有機EL素子200の表示電極の面積を増やすことができる。

[0042]

このように構成することにより、赤色R、緑色G及び青色Bの3つの発光部の有機EL素子200が別々の走査時に信号が送れるようになる。さらに、R、G及びBの3つの有機EL素子の特性の差を補正しやすくなる。アノードライン12並びにカソードライン15a及び15bを介して、別々に順方向電圧及びバイアス電圧を供給できるからである。

[0043]

さらに、有機薄膜スイッチング素子10及び11のキャリア注入用のゲート電極及び中間電極には、移動電荷が正孔の場合は電極と有機薄膜の間を正孔が移動しやすい高仕事関数の良電導性の材料を用い、移動電荷が電子の場合は電極と有機薄膜の間を電子が移動しやすい低仕事関数の良電導性の材料を用いる。さらに、中間電極についてはキャリア注入用の電極と相対する側に電荷の逆流を阻止する目的で、移動電荷が正孔の場合は低仕事関数の材料を、また、移動電荷が電子の場合は高仕事関数の材料を配置した2層構造の電極とすることもできる。この構造による有機薄膜と電極との仕事関数の差により、有機薄膜スイッチング素子のゲート及びドレインの電位が逆電位になったとしても、コンデンサからの電荷の漏洩が防止できる。

[0044]

次に、有機EL素子表示装置の第4の実施例の表示パネル109の製造工程を 説明する。 図18に示すように、まず、それぞれITOからなるアノードライン12と、カソードライン15 aと、カソードライン15 aに接続されるコンデンサ300 bの一方の電極302 bと、走査信号ライン16と、走査信号ライン16に接続される有機薄膜スイッチング素子11のゲート電極7と、データ信号ライン13 と、第1表示電極の透明電極(陽極)201とを、ガラス基板1上に形成する。電極302 b上には有機薄膜スイッチング素子10のソース電極及びゲート電極が形成されるべき領域55 a及び66 aが存在する。各ライン上には必要に応じてA1などの低い抵抗率の金属を更に積層してもよい。

[0045]

次に、図19に示すように、ITOの各導電部を備えている基板1の上に、発 光する有機エレクトロルミネッセンス材料層を含む有機材料層を積層させるため に第1表示電極の透明電極201を露出させる開口を有した感光性ポリイミド等 の絶縁層3を成膜する。ここで、有機薄膜スイッチング素子11をデータ信号ラ イン13へ接続するためのゲート及びソース用のコンタクトホール13bと、有 機薄膜スイッチング素子10のアノードライン12に接続するためのソース用の コンタクトホール12bと、走査信号ライン16をアノードライン12、カソー ドライン15a及びデータ信号ライン13を絶縁層3を介して跨いで交差させる ための接続用コンタクトホール16a及び16bとを絶縁層3に形成しておく。

[0046]

次に、図20に示すように、有機薄膜スイッチング素子11のドレイン電極6と、これをコンデンサ300bに接続するための導電部6aとからなるA1などの積層帯状体66を、電極302b及びゲート電極7上にフォトエッチングなどにより成膜する。同時に、有機薄膜スイッチング素子10のための領域55a及び66a上に、それぞれソース電極5となる端部を有するA1などの帯状体5aと、同じくソース電極6となる端部を有するA1などの帯状体6aと、を絶縁層3上に真空蒸着などで成膜する。A1などの帯状体5aにおける有機薄膜スイッチング素子10の電極となる側の反対の他端部はコンタクトホール12aを介してアノードライン12に接続され、帯状体6aの有機薄膜スイッチング素子10の電極となる側の反対の他端部は第1表示電極の透明電極201にそれぞれ接続

される。これら電極の成膜工程において、接続用のコンタクトホール13bと、 コンタクトホール16a及び16bとをA1などの蒸着により埋め込み、それぞ れ接続部133b、166a及び166bを同時に形成しておく。

[0047]

次に、図21に示すように、電子輸送性及び又は正孔輸送性の有機物いわゆる 有機半導体41を、有機薄膜スイッチング素子10及び11の電極5及び6上に 薄膜として、成膜する。同時に、同じ材料の有機半導体41aを第2の絶縁膜と して、所望の部位に成膜する。有機半導体41の一部はコンデンサ300bの誘 電体層の機能をも果たす。

[0048]

次に、図22に示すように、コンデンサ300及び300bの共通の陽極側となるA1などの電極301を成膜する。電極301の有機薄膜スイッチング素子10側はそのゲートG2の電極7となる。また、電極301の反対側の端部は導電部6aに接続される。同時に、有機薄膜スイッチング素子11となるべき部分にはA1などからなるソース電極2を、データ信号ライン13の接続部133bに接続させて有機半導体41の膜の上に成膜する。

[0049]

次に、図23に示すように、正孔輸送層など有機EL素子に必要な有機材料の 薄膜4の1層又はそれ以上を基板全面に成膜する。なお、ここで、埋められてい る第1表示電極の透明電極201に対応する有機材料薄膜4上に、所定のEL媒 体成膜用マスクを用い、R、G及びBの発光有機EL媒体4をそれぞれ所定膜厚 に成膜する。なお、基板表面の平坦化をなすためや、コンデンサの容量調整のた めに、2つの有機薄膜スイッチング素子、有機EL媒体以外に、他の誘電体をそ の対応部分に成膜することもできる。

[0050]

次に、図24に示すように、成膜用マスクを取り除き、A1-Li等の低仕事 関数の金属を、成膜された3種類の有機EL媒体の上に蒸着、あるいはスパッタ 等の手段を用いて陰極の第2表示電極203として成膜する。この金属膜の膜厚 は支障のない限り厚く被着させても構わない。この第2表示電極形成工程では、 図25に示すように、下層のアノードライン12及びデータ信号ライン13に交差するように、隣接する第2表示電極203を接続するカソードライン15aを同時に成膜し、更に同時にカソードライン15に接続するコンデンサの対向電極302や、有機薄膜スイッチング素子11のゲート電極G1も成膜する。

[0051]

作製された有機EL素子表示装置における有機薄膜スイッチング素子11及び10の断面図をそれぞれ図26に示す。有機薄膜スイッチング素子11、10及び有機EL素子200が略同一平面に形成されている。

具体的に本実施例及び比較例の有機薄膜スイッチング素子を作製した。まず、比較例として、有機薄膜FETを作製した。ガラス基板上にAuのゲート電極を形成し絶縁層S i_3 N $_4$ で埋め込み、絶縁層の上にAuのソース電極とドレイン電極を蒸着し、有機薄膜として $100\sim200$ Å膜厚のポリヘキシルチオフェン(P3HT)をメピンコートで成膜する。チャネル長を 5μ mチャネル巾を 1000μ mとした時にゲート電圧が-50 V、ドレインとソース間電圧が-40 Vで 280μ Aの電流をスイッチングできた。この時、ポリヘキシルチオフェンの導電率は 10^{-8} S/c m以下、移動度は $0.05\sim0.1$ c m 2 /V s、電流のOn/Off比は 10^6 以上であった。

[0052]

有機E L素子フルカラーディスプレイではサブピクセルの寸法が 0. $1\,\mathrm{mm}\times$ 0. $3\,\mathrm{mm}$ の時に、 $1\,\mathrm{0}\,\mu$ A以上の電流が流せれば必要な輝度がとれることから、比較例の有機FETはOn/Off比で $1\,\mathrm{0}^6$ を超えており、チャネル長が $5\,\mathrm{mm}$ 、チャネル中が $1\,\mathrm{0}\,\mathrm{0}\,\mu$ mの時に $2\,\mathrm{0}\,\mu$ A以上の電流が制御できるので性能的には充分といえるが、駆動電圧が高いのが難点であった。

[0053]

次に、本実施例の具体的な有機薄膜スイッチング素子ではゲート電極下に無機 絶縁膜を使わずに、直接キャリアをチャネルに注入する構造になるので、ゲート 電圧を低く設定できた。また、チャネル長は有機薄膜の膜厚方向にとれるので、 0. 1μ m以下となり、チャネル巾を $2 8 \mu$ mとし、キャリア注入時の有機薄膜 のキャリア移動度を $0.1 cm^2/V$ s としたとき、ゲート電圧が 7 V で 10μ

特平11-056102

Aの電流を流すのに必要なソースとドレイン間の電圧は 0.3 6 Vと極めて低い電圧になった。なお、Ε L 発光部の開口率は約 5 4 %、データ信号保持用のコンデンサーの容量は 0.5 8 p F となり、ライン巾はフォトプロセスの部分が 5 μ m以上、蒸着プロセスの部分が 1 0 μ m以上で構成できた。

[0054]

【発明の効果】

以上の如く本発明によれば、従来の有機EL素子表示装置製造方法より工程が少なく、低温プロセスを製造を可能とする有機薄膜スイッチング素子を得ることができる。有機EL素子とこの有機薄膜スイッチング素子を組み合わせ、さらにメモリー用の容量も有機薄膜で形成することで、有機薄膜成膜プロセスだけでディスプレイパネルが作成できる。シリコン基板を使わずに有機薄膜でスイッチング素子を作成できるので、有機ELパネルの単純な製造プロセスで、アクティブマトリクス駆動方式の有機EL素子表示装置の大型フルカラーディスプレイが作成可能になる。

[0055]

スイッチング素子により有機EL素子を個別に制御できるので、数Vの直流での高速スイッチング、低電圧駆動が可能になり、高効率、高輝度、長寿命のフルカラーディスプレイができる。デジタル駆動方式なので、今後拡大するデジタルソースに容易に対応できるフルカラーディスプレイになる。有機EL素子は光電変換機能を持っているので、デジタル駆動方式と合わせてインテリジェントなフルカラーディスプレイに展開できる可能性がある。

【図面の簡単な説明】

【図1】

有機EL素子表示装置の部分拡大断面図。

【図2】

有機EL素子の等価回路を示す図。

【図3】

本発明による実施例の有機薄膜スイッチング素子の概略断面図。

【図4】

特平11-056102

本発明による他の実施例の有機薄膜スイッチング素子の概略断面図。

【図5】

本発明による実施例のアクティブマトリクス駆動方式の有機EL素子表示装置 における表示パネルの一部を示す平面図。

【図6】

本発明による実施例の有機EL素子表示装置の表示パネル上に形成された有機 薄膜スイッチング素子及び有機EL素子を示す回路図。

【図7】

本発明による実施例の有機EL素子表示装置の表示パネルの製造工程における 基板の概略部分拡大平面図。

【図8】

本発明による実施例の有機EL素子表示装置の表示パネルの製造工程における 基板の概略部分拡大平面図。

【図9】

本発明による実施例の有機EL素子表示装置の表示パネルの製造工程における 基板の概略部分拡大平面図。

【図10】

本発明による実施例の有機EL素子表示装置の表示パネルの製造工程における 基板の概略部分拡大平面図。

【図11】

本発明による実施例の有機EL素子表示装置の表示パネルの製造工程における 基板の概略部分拡大平面図。

【図12】

本発明による実施例の有機EL素子表示装置の表示パネルの製造工程における 基板の概略部分拡大平面図。

【図13】

図5の線AAの断面図。

【図14】

図5の線BBの断面図。

【図15】

本発明による実施例の有機EL素子表示装置を示すブロック図。

【図16】

本発明による他の実施例のアクティブマトリクス駆動方式の有機EL素子表示 装置における表示パネルの一部を示す平面図。

【図17】

本発明による他の実施例の有機EL素子表示装置の表示パネル上に形成された 有機薄膜スイッチング素子及び有機EL素子を示す回路図。

【図18】

図16に示す実施例の有機EL素子表示装置の表示パネルの製造工程における 基板の概略部分拡大平面図。

【図19】

図16に示す実施例の有機EL素子表示装置の表示パネルの製造工程における 基板の概略部分拡大平面図。

【図20】

図16に示す実施例の有機EL素子表示装置の表示パネルの製造工程における 基板の概略部分拡大平面図。

【図21】

図16に示す実施例の有機EL素子表示装置の表示パネルの製造工程における 基板の概略部分拡大平面図。

【図22】

図16に示す実施例の有機EL素子表示装置の表示パネルの製造工程における 基板の概略部分拡大平面図。

【図23】

図16に示す実施例の有機EL素子表示装置の表示パネルの製造工程における 基板の概略部分拡大平面図。

【図24】

図16に示す実施例の有機EL素子表示装置の表示パネルの製造工程における 基板の概略部分拡大平面図。

特平11-056102

【図25】

図16に示す実施例の有機EL素子表示装置の表示パネルの製造工程における 基板の概略部分拡大平面図。

【図26】

図25の線CCの断面図。

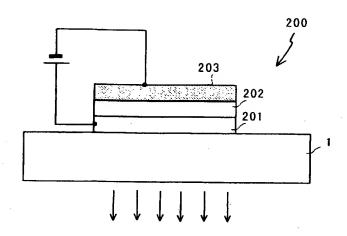
【符号の説明】

- 1 基板
- 2、7 ゲート電極
- 3 絶縁層
- 4 有機薄膜
- 5、6 金属電極
- 10、11 有機薄膜スイッチング素子
- 12 アノードライン
- 13 データ信号ライン
- 15 カソードライン
- 16 走査信号ライン
- 101 A/D変換回路
- 102 演算回路
- 103 フレームメモリ
- 104 コントローラ
- 105 走査回路
- 106 書き込み回路
- 107 電源回路
- 108 電流値メモリ
- 109 表示パネル
- 200 有機EL素子
- 300、300b コンデンサ

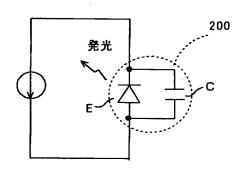
【書類名】

図面

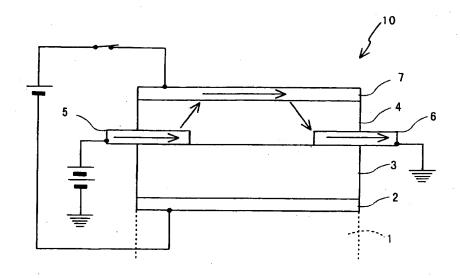
【図1】



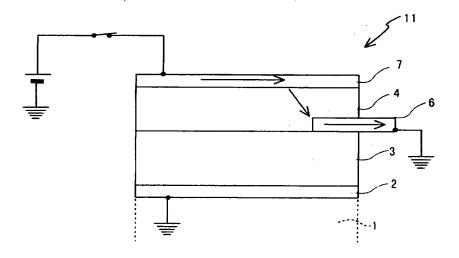
【図2】



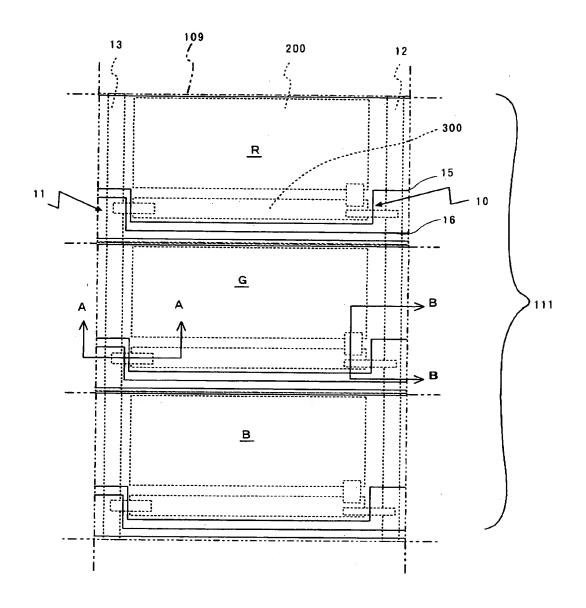
【図3】



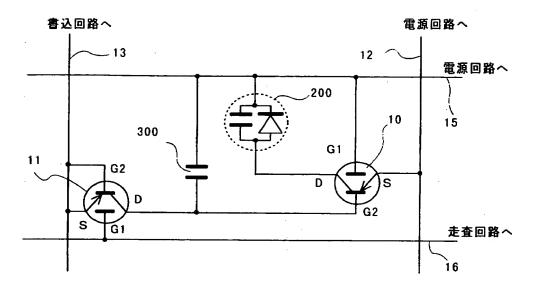
【図4】



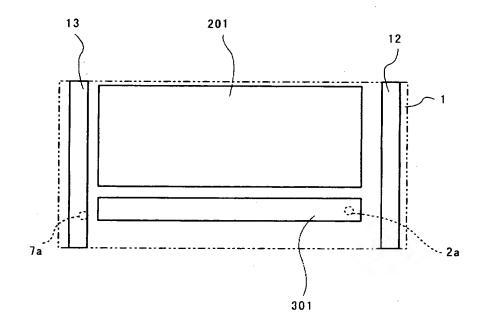
【図5】



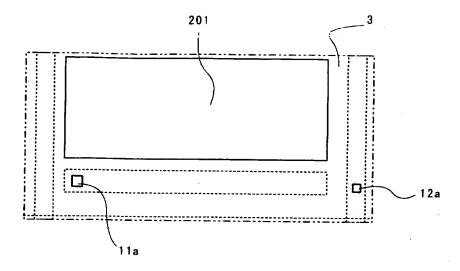
【図6】



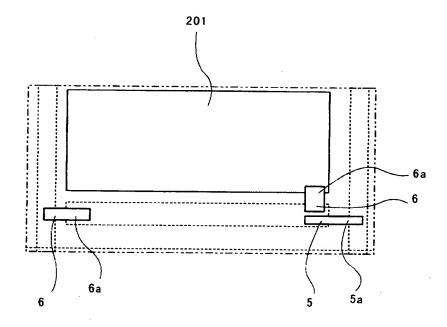
【図7】



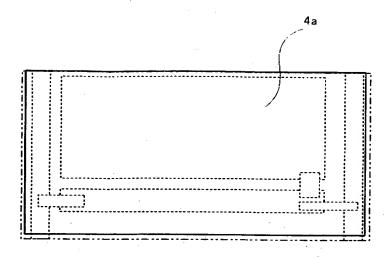
【図8】



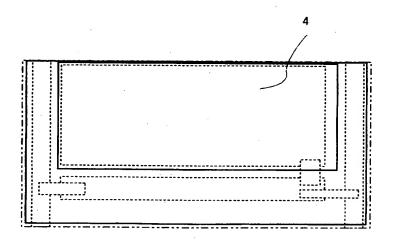
【図9】



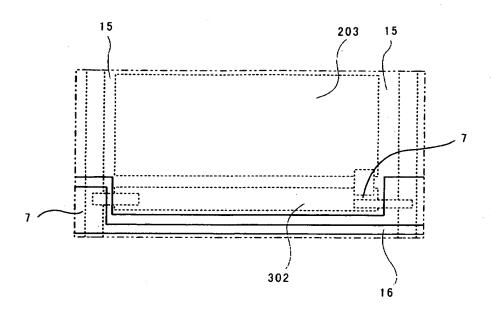
【図10】



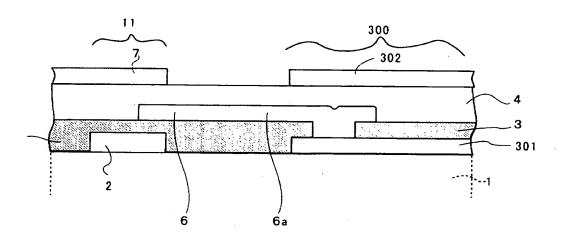
【図11】



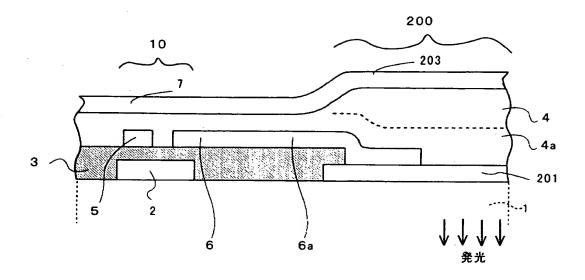
【図12】



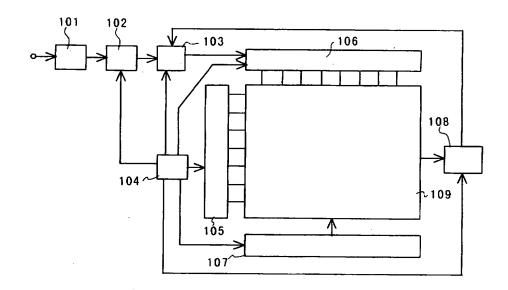
【図13】



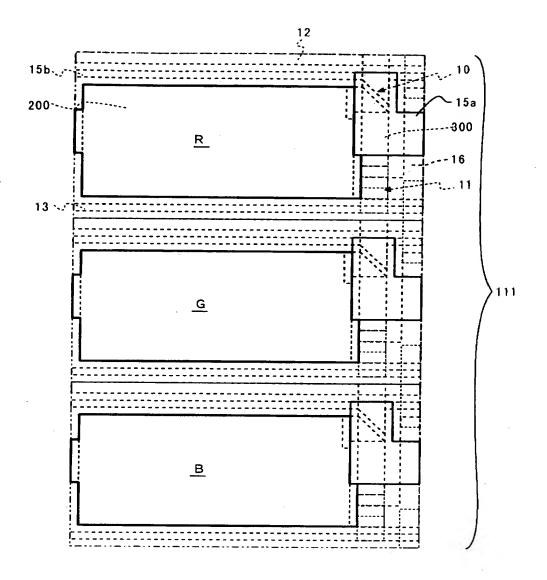
【図14】



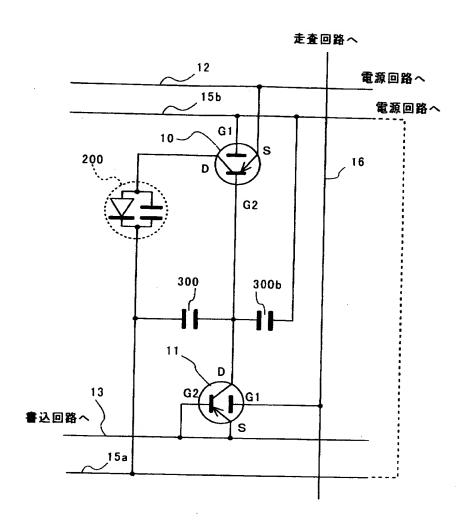
【図15】



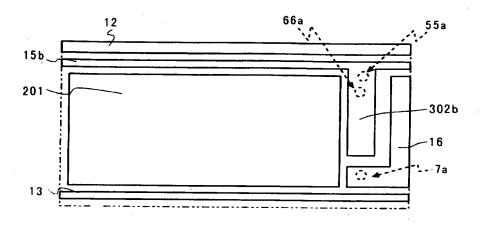
【図16】



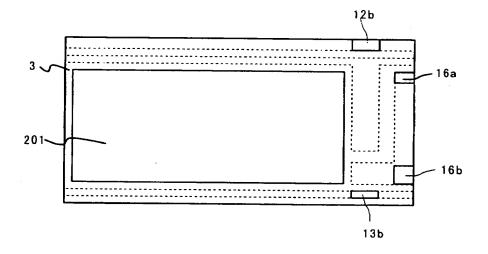
【図17】



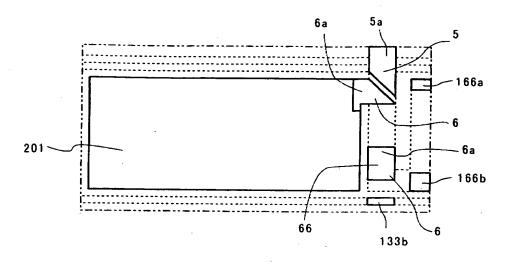
【図18】



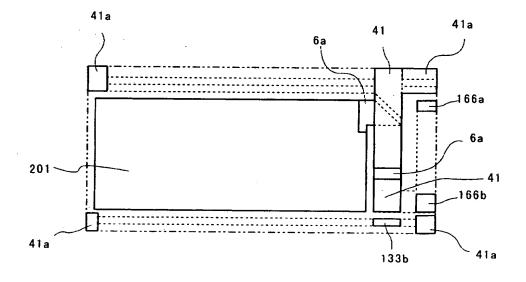
【図19】



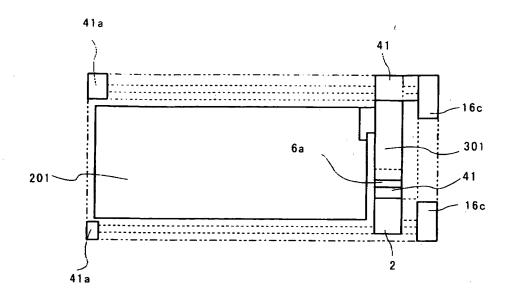
【図20】



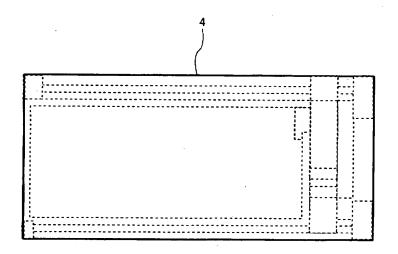
【図21】



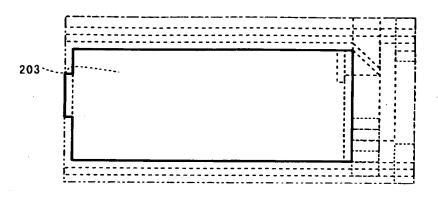
【図22】



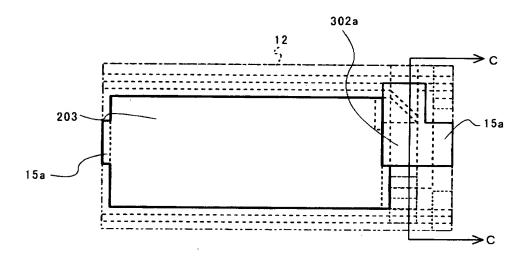
【図23】



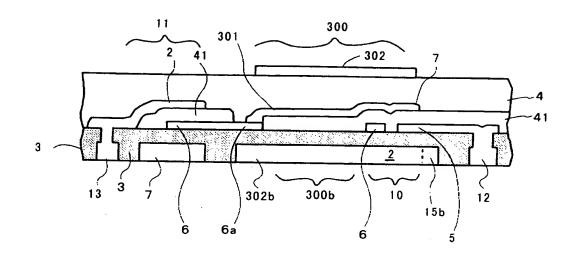
【図24】



【図25】



【図26】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 有機薄膜スイッチング素子を提供すること、並びに有機薄膜スイッチング素子を共通の基板上に形成した有機 E L 素子表示装置を提供する。

【解決手段】 複数の発光部からなる表示配列を有している有機エレクトロルミネッセンス素子表示装置であって、発光部に対応する複数の第1表示電極が表面上に形成された基板と、第1表示電極の各々上に形成され、少くとも1層の電子及び又は正孔の注入によって発光する有機エレクトロルミネッセンス材料層を含む有機材料層と、有機材料層上に共通に形成された第2表示電極と、基板上に形成されかつ第1及び2表示電極の少なくとも一方に接続された有機薄膜スイッチング素子と、からなる。有機薄膜スイッチング素子は、互いに積層された絶縁膜及び有機物からなる薄膜を挟む一対の対向するゲート電極、並びに、ゲート電極間の薄膜及び絶縁膜間の界面に配置された中間電極からなる。

【選択図】 図3

特平11-056102

出願人履歴情報

識別番号

[000005016]

1. 変更年月日 1990年 8月31日

[変更理由] 新規登録

住 所 東京都目黒区目黒1丁目4番1号

氏 名 パイオニア株式会社